

## 知的財産報告書

当社のコア技術は、半導体およびFPD製造のためのプロセス技術およびメカトロニクス技術であり、製品競争力強化のための技術開発を推進しています。そして、さらなる成長のための取り組みとして、①技術開発強化による新製品の創出と拡販、②高効率生産によるコスト競争力の強化、③新規事業創出による規模の成長、をテーマとして掲げて事業を進めています。このような取り組みのもと、独自開発した自社技術および自社製品の知的財産権による保護なくしては、ビジネスを円滑に進めることができません。当社は、知的財産戦略が技術戦略および製品戦略と三位一体となることによって初めて、期待した効果が最大限に発揮され则认为しています。

また、最近では、顧客であるデバイスメーカーのニーズが多様化するとともに、安定したプロセス性能・量産性能を發揮できる製造装置が求められるようになってきており、半導体製造技術において装置メーカーの役割が増大してきています。このような状況の中で、当社におきましても、装置レシビヤ、ソフトウェア技術、ならびに複数の製造装置のプロセス管理技術などに関する特許出願による対応を積極的に行うことで保護強化に努めています。

### 知的財産の取得・管理、営業秘密管理、技術流出防止に関する方針

当社においては「知的財産権に関する規程」で知的財産権の取り扱いについて定めており、自己の業務を通じて発明・考案・創作をした社員には、特許、実用新案、意匠などの出願時に一時金と、社内実施、ライセンスなどの社外実施の実績に応じた補償金とを支払うこととしています。

また、営業秘密などは、「技術・営業情報管理規程」および「技術・営業情報管理運用マニュアル」に基づいて厳密に管理しており、「営業秘密管理指針」（経済産業省発行）および「技術流出防止指針」（同）で定められる内容とはほぼ同等の管理内容となっています。このほか、実効性を高めるため、社内教育およびフォローアップなどを通じて運用の徹底を図っています。

### 知的財産権の出願状況

2008年3月末日時点での当社国内外における特許出願状況は、別表のとおりです。すでに、全体的には国内外への特許取得の厳選化を進めています。各事業分野における製造拠点・市場を考慮し、日本を含む出願国の見直しを実施しています。特に、過去数年間の施策であった米国への出願強化のほか、東アジアを中心とした新興の競合会社対策として、中国、韓国、台湾などへの出願強化を行っています。

### ライセンス関連活動の事業への貢献

当社は、自社開発製品や開発技術について、出願・権利化に成功した知的財産権を競合他社にライセンスアウトすることで収益を上げるのではなく、自社製品における技術的差別化や競争優位性確保を重点として、知的財産戦略を構築・実行しています。技術がますます高度化、複雑化している半導体およびFPD製造装置分野では、最先端技術を導入した新製品を効率良く開発し早期に市場投入するために、あらゆる知的財産権を有効に活用することが必要です。当社は、最先端技術の導入、研究開発効率の向上、新製品の早期市場投入を重視し、自社開発による知的財産の利用と同様に他社の知的財産を尊重し、ライセンスインなどを行うことで有効活用しています。

### 社外からの評価

知的財産情報の活用に関わるコンサルティングや情報提供サービスなどを手がけるSBIインテックストラ株式会社のまとめによる「技術競争力の強化パフォーマンス(特許1件あたりのPCI®)ランキング」において、当社が第1位の評価をいただきました。これは、当社が「質の高い研究開発成果を出すために多くの研究開発費を投じ、他社が注目する質の高い技術を輩出することで事業の優位性を確保している」と評価されたことによるものです。

また、2008年4月18日「発明の日」に、経済産業省特許庁より、平成20年度「知財功労賞[経済産業大臣表彰(特許戦略優良企業)]」を受賞いたしました。これは、当社の「特許査定率およびグローバル出願比率が高い点」「知財・法務担当副会長を筆頭に戦略的な知財活動を推進している点」などを評価していただいたことによるものです。

### 年度別特許出願件数

